特性關係圖。

- 10. 簡述實際接面二極體中的崩潰現象與崩潰電壓(breakdown voltage)。
- 11.已知在溫度為 300K 時的某 p^+-n 矽單側陡接面的 $N_A=10^{19} cm^{-3}$,請利用圖 2-23 分別求當 $N_D=10^{16} cm^{-3}$ 與 $N_D=5\times 10^{15} cm^{-3}$ 時之接面崩潰電壓。並利用 得到的數據進一步驗證(2.74a)的近似關係式成立。
- 12.請利用圖 2-24 與 (2.73) 式,重複上一問題。
- 13.鑑於淺接面技術(shallow junction technique)對於短通道 CMOS 元件(註:將在第五章介紹)的重要性,請討論接面深度 x_i 對接面崩潰電壓之影響。